文章编号: 0258-7025(2009)06-1356-04

大功率 980 nm InGaAs/InGaAsP/InGaP 激光器热特性

裘利平 郭伟玲 罗丹 崔碧峰 张 蕾 沈光地 (北京工业大学北京光电子技术实验室,北京 100022)

摘要 利用低压金属有机化学气相沉积(LP-MOCVD)生长了无铅 980 nm InGaAs/InGaAsP/InGaP 单量子阱 (SQW)激光器,测试了含铅的 InGaAs/GaAs/AlGaAs 和无铅的 InGaAs/InGaAsP/InGaP 两种不同材料的 980 nm InGaAs SQW 激光器在 30~70 ℃范围内的 P-I-V 特性曲线,对比分析了两种材料系 980 nm 激光器输出光功率、阈值电流、斜率效率和激射波长随温度的变化,并对 InGaAs/InGaAsP/InGaP 激光器进行了可靠性实验。

关键词 激光器;大功率激光器;热特性;无铝;特征温度

中图分类号 TN248.4 文献标识码 A doi: 10.3788/CJL20093606.1356

Thermal Property of High Power 980 nm InGaAs/InGaAsP/InGaP Laser Diodes

Qiu Liping Guo Weiling Luo Dan Cui Bifeng Zhang Lei Shen Guangdi (Beijing Optoelectronic Technology Laboratory, Beijing University of Technology, Beijing 100022, China)

Abstract An aluminum-free InGaAs/InGaAsP/InGaP single quantum well (SQW) laser diode (LD) is grown by low-pressure MOCVD. The *P-I-V* characteristics of Al-free and Al-containing 980-nm InGaAs lasers are tested in temperature range of 30-70 $^{\circ}$ C. The variations with temperature of the two different LDs' characteristic parameters, including output power, threshold current, slope efficiency, and the wavelength, are analyzed contrastively. The reliability experiments on the InGaAs/InGaAsP/InGaP laser diodes are also carried out.

Key words lasers; high power laser; thermal characteristics; Al-free; characteristic temperature

1 引 言

作为掺铒光纤放大器的理想抽运源^[1],大功率 980 nm 半导体量子阱激光器一直以来都是研究热 点。新一代光通信,特别是海底光纤通信系统要 求长达 25 年的寿命,这就对大功率 980 nm 半导 体量子阱激光器抽运源的可靠性与稳定性提出了 更高的要求。传统的 980 nm InGaAs/AlGaAs/ GaAs 材料体系容易实现晶格匹配、外延工艺成 熟,但是,温度较高时材料中的 Al 组分极易被氧 化,严重影响激光器的使用性能,同时也给制作工 艺带来一定的难度^[2,3]。无铝半导体激光器(LD) 克服了这些不足,随着研究的深入,已显示出许多 优点^[4]:1) InGaP 同氧的反应速率、表面复合速率 比 AlGaAs 要低得多,因此降低了激光器端面温 升,使灾变光学镜面损伤(COMD)阈值增大2倍以 上,同时 InGaP 较 AlGaAs 有更好的热学、电学传 导性,器件的串联电阻和热阻减小;2) InGaAsP 与 InGaP 中 In 原子体积较大,它牵制了位错的移动, 有效地阻止了暗点缺陷(DSD)和暗线缺陷(DLD) 的积累、扩散^[5]。上述优点有助提高器件的可靠 性,实现更长的使用寿命。本文通过变温测试对 InGaAs/InGaAsP/InGaP 分 别 限 制 异 质 结 构 (SCH)单量子阱(SQW)激光器的热特性进行研 究,并进行了可靠性实验。

基金项目:国家 863 计划(SQ2007AA03Z431230)资助课题。

作者简介: 裘利平(1983-),男,硕士研究生,从事半导体激光器可靠性方面的研究。E-mail: jxlqlp@emails. bjut. edu. cn 导师简介: 郭伟玲(1966-),女,副教授,从事半导体光电子器件方面的研究。E-mail: guoweiling@bjut. edu. cn

收稿日期: 2008-10-14; 收到修改稿日期: 2008-12-04

2 结构设计和样品制备

实验采用的 980 nm 无铝激光器结构如图 1 所 示。在(100)偏(111)晶向 2°的 n 型 GaAs 衬底上,利 用金属有机化学气相沉积(MOCVD)系统依次生长 0.2 μm n⁺-GaAs 缓冲层,2 μm n-GaInP 下限制层, 70 nm $In_{1-x}Ga_xAs_vP_{1-v}$ 线性折射率渐变下波导层, 8 nm $In_{0.2}$ Ga_{0.8} A 单量子阱层, 70 nm In_{1-x} $Ga_x As_y P_{1-y}$ 线性折射率渐变上波导层,2 μm p-GaInAsP上限制层,0.2 μm p⁺-GaAs 层。外延片 p 面蒸镀 SiO₂, 光刻、腐蚀成 50 μ m 的条宽, 深度 520 nm, 淀积 Ti/ Au 合金; n 面化学动力减薄后蒸镀 AuGe/Ni/Au 合金,解理成腔长 800 µm 的管芯,用电 子束蒸发镀膜方法为激光器蒸镀 Si/Al₂O₃ 高反膜及 Al_2O_3 增透膜,镀膜环境的真空度为 9×10^{-5} Pa,温度 为120~170℃。为了减小器件的热阻,提高器件的 热特性,用AuSn 焊料将解理后的管芯倒装焊接在铜 热沉上。图 2 为实验所用腔长800 µm,条宽 50 µm 无 铝样品 LD 的 P-I-V 及远场特性,器件在 1000 mA 直 流工作下输出光功率812 mW,阈值电流 132 mA,斜 率效率 0.97 W/A, 激射波长 976.6 nm, 垂直和水平 远场发散角分别为 34.2°和 6.6°。

3 变温测试

对含铝的 InGaAs/GaAs/AlGaAs 和无铝的 InGaAs/InGaAsP/InGaP 两种不同材料的 980 nm InGaAs SQW 激光器在 30~70 ℃范围内进行了 *P*-*I*-V 特性测试。为了减小器件本身发热对结 温的贡献,影响后续特征温度 T_0 及 $\Delta\lambda/\Delta T$ 的计算,变 温测试在频率为 50 Hz,占空比为 0.5%的脉冲条件 下进行^[6],这样结温近似地等于环境温度,即温箱温 度。图 3 为在 30~70 ℃范围内测得的有铝和无铝 器件的 *P-I-V* 特性随温度的变化曲线。



- 图 1 InGaAs/InGaAsP/InGaP 980-nm InGaAs 应变单量子 阱激光器结构示意图
 - Fig. 1 Schematic structure of InGaAs/InGaAsP/InGaP 980-nm InGaAs strained SQW laser diode



图 2 LD 远场及 L-I-V 特性



Fig. 2 Far-field and L-I-V characteristics of the Al-free LDs

图 3 (a) InGaAs/InGaAsP/InGaP激光器和(b) InGaAs/GaAs/AlGaAs激光器在 30~70 C范围内的 P-I-V 特性曲线 Fig. 3 P-I-V characteristics of InGaAs/InGaAsP/InGaP LD (a) and InGaAs/GaAs/AlGaAs

LD (b) with temperature from 30 $^\circ\!\!C$ to 70 $^\circ\!\!C$

度分别为 8.8% 和 9%。

4 实验结果与讨论

图 4 为 30~70 ℃温度范围内测得的有铝和无

从图 3 中可看出,随着温度的升高,在相同的激励电流下激光器输出功率,在该温度范围内,有铝和无铝器件的最大输出功率分别由 880.4 mW 和 936.5 mW 下降到 802.7 mW 和 852.2 mW,下降幅







从图 4 中可看出,随着温度的升高,激光器斜率 效率下降,在该温度范围内,有铝、无铝器件的斜率 效率分别由 1.12 和 0.99 下降到 1.05 和 0.91,下 降速率分别为一0.0015/℃,一0.0013/℃。激光器 的输出光功率可以表示为

$$p_{0} = \eta_{i} \frac{\alpha_{m}}{\alpha_{i} + \alpha_{m}} \frac{h\nu}{q} (I - I_{th}), \qquad (1)$$

式中 ŋ 为内量子效率, a 为内损耗, a 为端面损耗。 随着温度的升高, 激光器的内损耗及载流子的泄露 增加, 内量子效率减小, 导致外微分量子效率降低 所致。

图 5 是无铝和有铝激光器阈值电流与温度的 关系曲线,从图中可以看出,阈值电流随温度升 高而增加,这是因为随温度的升高,注入的载流 子能量分布展宽,造成透明载流子浓度增加所引 起的。同时,为达到阈值而增加的载流子密度又 增大了内损耗,增益和内损耗的变化以及载流子 的泄露等因素导致了激光器的阈值电流随温度 的变化。

当腔长 L 为确定值时,半导体激光器的阈值电流 I_{th}与温度 T 之间的关系符合^[7]

$$I_{\rm th}(T) = I_{\rm th}(T_1) \exp\left(\frac{T - T_1}{T_0}\right),$$
 (2)

式中 T_1 为室温, $I_{th}(T_1)$ 为室温下的阈值电流, T_0 为激光器的特征温度。特征温度 T_0 通常表示阈值 电流 I_{th} 对温度 T 的敏感程度, 是衡量激光器特性的 重要参数之一。 T_0 值越大, 表明阈值电流对温度的 敏感程度越小, 即激光器的热特性越好。由(2)式可 以确定激光器的特征温度 T_0 。通过实验数据拟合 得到两种器件阈值电流 $\ln I_{th}$ 随温度 T 变化曲线如 图 5 示。





由(2)式可知图 5 中曲线的斜率的倒数即为器 件的特征温度,实验测得无铝与含铝激光器特征温 度 T_0 分别为 77 K和 209 K。对比两者的特征温度 大小可知,InGaAs/InGaAsP/InGaP激光器的热特 性比 InGaAs/GaAs/AlGaAs激光器的要差^[8],这是 因为,无铝激光器波导层 InGaAsP($E_g \approx 1.62 \text{ eV}$) 和限制层 InGaP($E_g \approx 1.9 \text{ eV}$)禁带宽度差约为 0.28 eV,而 InGaAs/GaAs/AlGaAs激光器中波导 层与限制层的禁带宽度差约为 0.4 eV,较小的导带 差^[9,10]造成了载流子泄漏,当温度升高时,热载流子 泄漏 也 趋于严重^[11],从 而导 致 了 InGaAs/ InGaAsP/InGaP 激光器较高的阈值电流密度,较低 的特征温度 T_0 。

图 6 是在 30~70 ℃之间两种激光器激射波长 随温度的变化关系,从图中可清楚地看到激射波长 随温度升高呈线性变化,且向长波方向移动,红移速 率都为 0. 29 nm/℃,这与文献[12~14]提到的 0.3 nm/℃吻合,也说明芯片结温与环境温度相等, 脉冲测试条件没有引入芯片自升温。



图 6 30~70 ℃范围内两种器件波长随温度的变化 Fig. 6 Wavelength of the two different LDs at different temperatures in the range of 30-70 ℃

1359

5 加速寿命老化实验

采用在位老化监测系统对 5 支无铝激光器进行 加速寿命老化实验,老化时热沉温度为 50 °C,老化 电流为恒流 1000 mA,老化时间为 3000 h,老化过 程中每间隔 5 min 在位监测包括阈值电流、光谱波 长、光功率、正向压降等器件参数。其中当 LD 输出 光功率 P_{out} 下降为老化前的 50%时,判断为失效。 图 7 为 5 支无铝激光器在对应老化时间 t 的输出光 功率 P_{out} ,由图中可以看出,在长达 3000 h 的高温 大电流加速老化后,5 支无铝激光器除 1 号 LD 输出 光功率下降了 16%以外,其他 LD 输出光功率几乎 没有下降,表明器件具有较高的可靠性。





6 结 论

对含铝的 InGaAs/GaAs/AlGaAs 和无铝的 InGaAs/InGaAsP/InGaP两种不同材料的 980 nm 单量子阱激光器进行了变温测试实验。并对无铝激 光器进行了加速寿命老化实验,实验结果表明,与 InGaAs/GaAs/AlGaAs 材料的 980 nm 激光器相 比,无铝材料的 980 nm 激光器有较高的可靠性,但 由于 InGaP 材料对载流子限制能力较弱导致其热 特性较差,有更高的阈值电流和更低的特征温度。 可以采用多量子阱结构^[15~18]来提高器件对载流子 的限制能力,改善器件的温度特性。

参考文献

1 Ma Yan, He Jun, Xie Fuzeng. 980 nm non-anti-reflection-coated fiber grating laser for single-longitudinal mode operation[J]. Acta Optica Sinica, 2004, 24(6):821~824

马 艳,何 军,谢福增.980 nm 单模运转未镀增透膜光纤光栅 激光器[J]. 光学学报, 2004,**24**(6):821~824

2 W. E. Plano, J. S. Major, D. F. Welch et al.. High power 875 nm Al-free laser diode[J]. IEEE Photon. Technol. Lett., 1994, 6(4): 465~467

- 3 J. Diaz, K. Mobarhan, E. Kolev et al.. InGaP/InGaAsP/GaAs
 0.808 μm separate confinement laser diodesgrown by MOCVD
 [J]. IEEE Photon. Technol. Lett., 1994, 6(2): 132~134
- 4 Li Zhonghui, Wang Yuxia, Wang Ling *et al.*. 850 nm Al-free active-region high power SCH-SQW laser[J]. *Chinese J. Lasers*, 2002. A29(1): 5~6

李忠辉,王玉霞,王 玲等. 850 nm 有源区无铝高功率 SCH-SQW 激光器[J]. 中国激光, 2002, **A29**(1):5~6

- 5 Yang Jinhua, Ren Dacui, Zhang Jianjia *et al.*. Study on optical characteristics of InGaAsP/GaAs SQW lasers[J]. *Chinese J. Lasers*, 2000, **A27**(8):687~690 杨进华,任大翠,张剑家等.InGaAsP/GaAs单量子阱半导体激光器光学特性的研究[J].中国激光,2000, **A27**(8):687~690
- 6 Song Haipeng, Wen Jimin, Zeng Xiongwen *et al.*. Research of pulse injection method for measuring LD chip temperature[J]. *Chinese J. Lasers*, 2005, **32**(3): 407~410 宋海鹏,温继敏,曾雄文 等. 测量激光器结温的脉冲注入法研究 [J]. 中国激光,2005,**32**(3): 407~410
- 7 Zhong Li, Wang Jun, Feng Xiaoming *et al.*. 808 nm high-power lasers with Al-free active region with asymmetric waveguide structure[J]. *Chinese J. Lasers*, 2007,34(8):1037~1042
 仲 莉, 王 俊, 冯小明等. 808 nm 大功率无铝有源区非对称波导结构激光器[J]. 中国激光, 2007,34(8): 1037~1042
- 8 A. Bhattacharya, L. J. Maws, S. Nayak et al.. Interface structures of InGaAs/InGaAsP/InGaP quantum well laser diodesgrown by metalorganic chemical vapor deposition on GaAs substrates[J]. Appl. Phys. Lett., 1996, 68(16):2240~2242
- 9 G. Zhang, A. Ovtchinnikov, J. Nappi et al., Far-field, efficiency and loss of 980 nm InGaAs/GalnAsP/GalnP SCH quantum well [J]. Electron. Lett., 1997,33(6):489~491
- 10 E. C. Vail, R. F. Nabiev, C. J. Chang-Hasnain. Temperature dependence of light-current characteristics of 0. 98-μm Al-free strained-quantum-well lasers[J]. *IEEE Photon. Technol. Lett.*, 1994, 6(11):1303~1305
- 11 Markus Pessa, Jari Nappi, Pekka Savolainen et al.. State-of-theart aluminum-free 980-nm laser diodes [J]. J. Lightwave Technol., 1996,14(10):2356~2361
- 12 Yongkun Sin, Brendan Foran, Nathan Presser *et al.*. Reliability and failure mode investigation of high power multi-mode InGaAs strained quantum well single emitters[C]. *SPIE*, 2007, **6456**: 645605
- 13 Luo Dan, Guo Weiling, Xu Chen *et al.*. Junction temperature measurement of semiconductor laser diode [J]. Semiconductor Optoelectronics, 2007, 28(2):183~190
 罗 丹,郭伟玲,徐 晨等. 半导体激光器结温测试研究[J]. 半导体光电, 2007, 28(2):183~190
- 14 Bo Baoxue, Gao Xin, Qiao Zhongliang *et al.*. Characteristics of high power volume-Bragg-grating external cavity semiconductor lasers[J]. *Chinese J. Lasers*, 2008, **35**(4):501~504 薄报学,高 欣,乔忠良等.大功率体光栅外腔半导体激光器的 输出特性[J]. 中国激光,2008, **35**(4):501~504
- 15 M. Sagawa, T. Toyonaka, K. Hiramoto *et al.*. High-power highly-reliable operation of 0. 98-μm InGaAs-InGaP straincompensated single-quantum-well lasers with tensile-strained InGaAsP barriers [J]. *IEEE J. Quantum Electron.*, 1995, **31** (2):189~195
- 16 H. Asonen, A. Ovtchinnikov, G. Zhang *et al.*. Aluminum-free 980-nm GaInAs/GaInAsP/GaInP pump lasers [J]. *IEEE J. Quantum Electron.*, 1994, **30**(2):415~425
- 17 M. Ohkubo, T. Ijichi, A. Iketani et al., 980-nm aluminum-free InGaAs/InGaAsP/InGaP GRIN-SCH SL-QW lasers[J]. IEEE J. Quantum Electron., 1994, 30(2):408~414
- 18 L. J. Mawst, A. Bhattacharya, M. Nesnidal et al.. High CW output power and 'wallplug' efficiency Al-free InGaAs/InGaAsP/ InGaP double quantum well diode lasers [J]. Electron. Lett., 1995, 37(14):1153~1154